

公司代码:688652

公司简称:京仪装备

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司在本报告书中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王忠清	出差未能出席	王忠清

注:公司董事王忠清因出差无法亲自出席,委托其配偶王忠清女士出席。

2025年4月,公司因工作需要多次与独立董事陈殿江先生联系,均无法联系上其本人,截至本报告公告日,公司仍无法与陈殿江先生取得联系。

5、致聘会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上月未盈利且尚未实现盈利

□是 ☒ 否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

经会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度实现的归属于母公司股东的净利润为152,911,820.19元,母公司实现的净利润为101,240,973.82元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利,具体利润分配方案如下:

1、上市公司向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本168,000,000.00股,以此计算合计拟派发现金红利21,000,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为13.73%。

2、本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 ☒ 不适用

第二节 公司基本情况

一、公司简介

1.1 公司股票简称

☒ 适用 ☒ 不适用

简称类型	股票上市交易所简称	公司股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	京仪装备
人民币普通股(B股)	上海证券交易所科创板	688652
人民币普通股(C股)	上海证券交易所科创板	无适用

姓名	郑娟芳	证券事务代表
联系地址	北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座	北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座
电话	010-58917326	010-58917326
传真	010-58917219	010-58917219
电子邮箱	zhengjuanfou@bjchic.com.cn	zhengjuanfou@bjchic.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

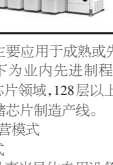
2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事半导体专用设备的研究、生产和销售,主营产品包括半导体专用温控设备(Chiller)、半导体专用工艺废气处理设备(LocalScrubber)和晶圆传片设备(Sorter)。公司自成立以来,主营业务发生重大变化。

公司产品主要包括半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备,具体如下:

类别	图示	产品主要技术指标/参数	应用领域
半导体专用温控设备			
单通道		温控范围: -45℃~120℃ 空载温控精度: ±0.05℃±0.2℃ 带载温控精度: ±0.5℃±1℃ 制冷能力: 5kW@-40℃, 3kW@-10℃, 1.5kW@30℃RH@0℃	在制程中主要对反应腔进行温度控制,主要应用于12英寸晶圆前道制程,化学气相沉积等工艺。批量应用于逻辑芯片90nm~1nm、64层~192层3D NAND存储芯片等各种工艺需求。适配经林半导体、东岳电子、应用材料、中微公司、北方华创、乾裕股份等设备公司的主工艺设备
双通道		温控范围: -70℃~120℃ 空载温控精度: ±0.05℃±0.2℃ 带载温控精度: ±0.5℃±1℃ 制冷能力: 8.5kW@-60℃, 3kW@-10℃, 1.5kW@211RH@0℃	在制程中主要对反应腔进行温度控制,主要应用于12英寸晶圆前道制程,化学气相沉积等工艺。批量应用于逻辑芯片90nm~1nm、64层~192层3D NAND存储芯片等各种工艺需求。适配经林半导体、东岳电子、应用材料、中微公司、北方华创、乾裕股份等设备公司的主工艺设备
三通道		温控范围: -45℃~120℃ 空载温控精度: ±0.05℃±0.2℃ 带载温控精度: ±0.5℃±1℃ 制冷能力: 6kW@-10℃, 4kW@-10℃, 1.5kW@30℃RH@0℃	在制程中主要对反应腔进行温度控制,主要应用于12英寸晶圆前道制程,化学气相沉积等工艺。批量应用于逻辑芯片90nm~1nm、64层~192层3D NAND存储芯片等各种工艺需求。适配经林半导体、东岳电子、应用材料、中微公司、北方华创、乾裕股份等设备公司的主工艺设备

类别	图示	产品主要技术指标/参数	应用领域
半导体专用工艺废气处理设备			
单柜		废气处理量(标准状况下)/分钟: 400m³/300m³ 废气处理效率: >99% 废气处理方式: 燃烧水洗式、等离子水洗、电热水洗式	主要应用于12英寸集成电路制造产线中前道、前道、中道等工艺。用于将工艺环节中产生的工艺废气进行无害化处理,批量应用于90nm~28nm逻辑芯片、64层~192层3D NAND存储芯片等各种工艺需求。适配经林半导体、东岳电子、应用材料、中微公司、北方华创、乾裕股份等设备公司的主工艺设备
双柜		废气处理量(标准状况下)/分钟: 800m³/1,600m³ 废气处理效率: >99% 废气处理方式: 燃烧水洗式	主要应用于12英寸集成电路制造产线中前道、前道、中道等工艺。用于将工艺环节中产生的工艺废气进行无害化处理,批量应用于90nm~28nm逻辑芯片、64层~192层3D NAND存储芯片等各种工艺需求。适配经林半导体、东岳电子、应用材料、中微公司、北方华创、乾裕股份等设备公司的主工艺设备

类别	图示	产品主要技术指标/参数	应用领域
晶圆传片设备			
二端口		产品单位时间全流程晶圆传送量 WPI: >330 机械手重复定位精度: ±0.1mm 缺口定位精度: ±0.2°	在制程中主要应用于晶圆的下片、制程前倒片的上控和上片/胶装、排布及有刷/需求工艺。批量应用于逻辑芯片90nm~28nm等各种工艺需求。适配经林半导体、东岳电子、应用材料、中微公司、北方华创、乾裕股份等设备公司的主工艺设备
四端口		产品单位时间全流程晶圆传送量 WPI: >330 机械手重复定位精度: ±0.1mm 缺口定位精度: ±0.2°	在制程中主要应用于晶圆的下片、制程前倒片的上控和上片/胶装、排布及有刷/需求工艺。批量应用于逻辑芯片90nm~28nm等各种工艺需求。适配经林半导体、东岳电子、应用材料、中微公司、北方华创、乾裕股份等设备公司的主工艺设备

公司产品主要应用于成熟或先进制程集成电路制造的12英寸集成电路制造产线。在逻辑芯片领域,28nm以下业内先进制程,公司产品已经适配国内最先进的14nm逻辑芯片制造产线,在30NAND存储芯片制造产线,128层以上(含128层)业内先进制程,公司产品已经适配国内最先进的192层3D NAND存储芯片制造产线。

2.2 主要经营模式

1、直销模式

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售业务,通过向下游半导体客户销售半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备、晶圆传片设备等产品实现收入和利润。报告期内,公司主营业务收入主要来源于半导体专用设备产品的销售。

2、采购模式

公司采购的原材料种类繁多,主要包括电器装置类、电气元件类、机械零部件类、机械加工件类、化学制品类、仪器仪表类等,其中,部分电器装置类部件及电气元件、机械零部件均由供应商提供的图纸自行采购原材料并安排加工后向公司提供。

为加强对供应商的管理及筛选,公司采购中心会同品质中心、研发中心及运营效率中心等下属的生产等部门定期对供应商进行遴选和评估,考虑供应商的资质能力、产品品质情况、供货及时性等方面,经考核通过后确定合格供应商名录,并跟踪考核进行持续更新。目前,公司已与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。

公司通过向供应商签署采购合同的方式开展采购业务。采购部根据生产、研发等部门提交并经公司批准采购信息文件(如采购申请单等),综合考察公司现有生产安排、销售订单、原材料库存、研发需求等情况安排采购计划,按要求在合格供应商名录中选择供应商并进行询价、比价,确定最终合格供方后再行采购。采购物资到达后,品质中心进行到货检验,检验合格后由采购中心及生产部办理入库手续,完成采购。

3、生产模式

公司主要采用自主研发模式,逐步取得了半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备、晶圆传片设备系列产品的制造能力。公司遵循“研产供销”模式,产品研发流程严格按照公司设计、研发流程进行。公司研发流程主要包含预研阶段、设计开发阶段、设计验证阶段、设计验证阶段、验收阶段、研发样机入场阶段、客户端验证(Demo)、生产导入阶段、收尾阶段。新品设计开发流程如下:

